第三节 固体能带理论简介

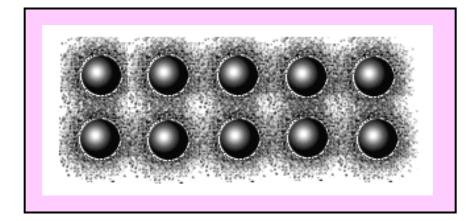
一、晶体的能带结构

二、导体,绝缘体,半导体

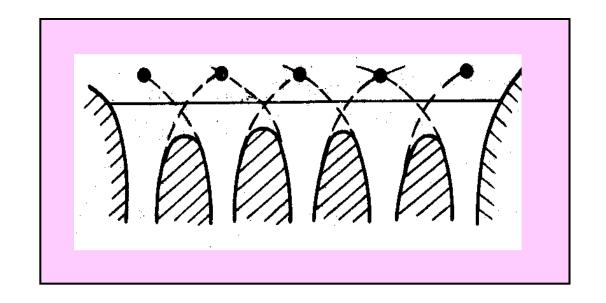
一、晶体的能带结构

晶体中能级 —— 能带 (由若干能级组成)

- 1.形成能带的原因
- (1)晶体中电子的状态 ——电子共有化
- •电子云重叠:相邻原子的电子云重叠,重叠区域中出现的电子不能简单归属于某一的电子不能有。有是电子或整个晶体共有。外层电子共有化趋向比内层电子更显著。



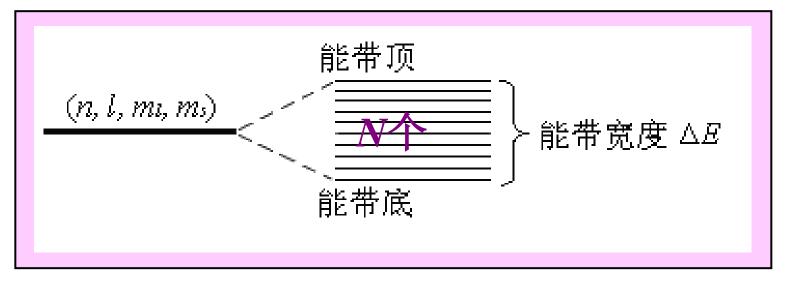
(2)晶体中电子的共有化运动



• 隧道效应: 一个原子中的电子有可能通过隧道 效应穿越势垒进入另一个原子, 出现一批不受特 定原子束缚的共有化电子。



(3) 泡利不相容原理



由于共有化电子彼此间量子数不能完全相同,于是各原子中能量相同的能级分裂为N个与原来能级接近的新能级,组成能带来容纳这些共有化电子。

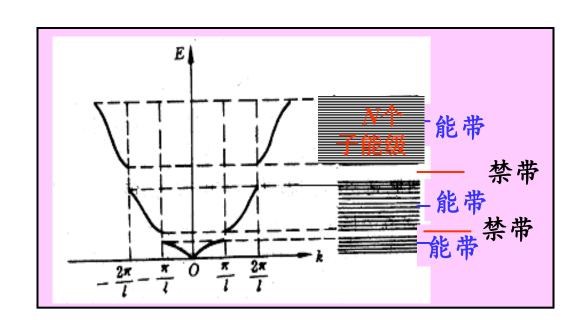
数量级概念:

晶格常数: $d\sim10^{-10}$ m, 1cm³中点阵数: $N\sim10^{23}$ - 10^{24}

能带宽度: $\triangle E$: 几个eV, 子能级间隔: 10^{-23} eV

2.能带特点

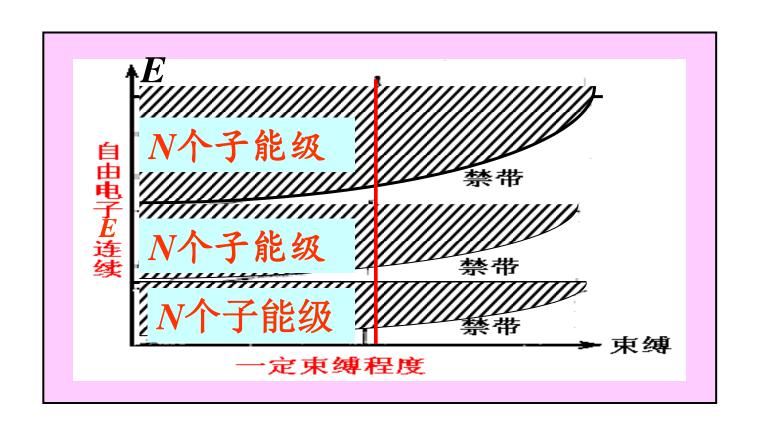
(1)能带由准连续的N个子能级组成,能带之间用禁带 分开,原子数N变化时,能带宽度不变,密度变化。



解方程得出:

自由电子能量曲 线为抛物线,在 一些位置断开。

(2)能带宽度随能量增加而增加,随离子对电子约束程度增加而减少。



(3)每个角量子数1一定的能带中最多容纳的电子数为:

2(2l+1)N

例: ns带 l=0, 最多容纳电子数为 2N np带 l=1, 最多容纳电子数为 6N

满带:被电子填满的能带

导带:未被电子填满的能带

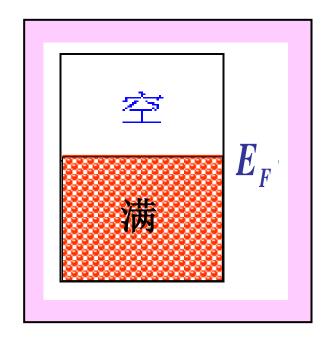


空带(激发态能级):完全未被电子填充的能带 _____

价电子:最外能级上的电子。



(4)电子总是先填满能量较低的能带。



费米能级(价电子能级): $T \longrightarrow 0$ K, 无激发电子,原子所占据的最大能级。

费米能: 费米能级对应的能量。

费米面: 费米能级对应的等能量面。

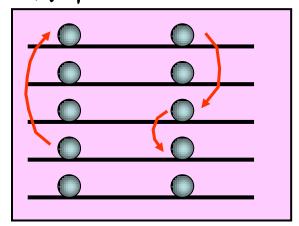
- (5)不同能带有可能重叠,其间禁带消失。
- (6)晶体中有杂质或缺陷时,破坏了周期性结构,禁带中可能出现杂质能级。



1.固体导电机理

以 l=0, 即每个子能级至多容纳 2 个电子, 能带中至多容纳 2N个电子为例:

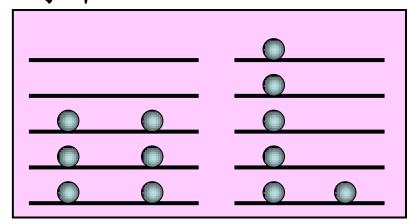
满带:



电子运动,分布不变。

满带中的电子运动不产生电流,无导电作用。

导带:



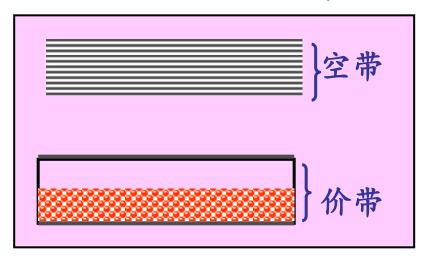
电子运动,分布变化。

导带中的电子运动可以形成电流,有导电作用。

- 2.导体,绝缘体,半导体的能带特征
 - (1)导体的能带特征
 - ①价带为导带

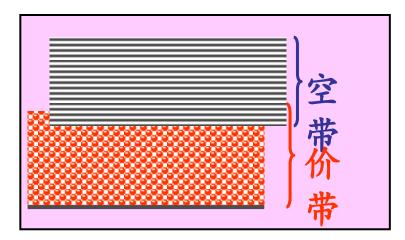
例:Li原子: 电子组态: $1s^22s^1$, 每个原子一个价电子(2s态), N个原子共有N个价电子。

N个Li原子形成固体时,2s能级分裂为能带(价带),有N个子能级。可容纳2N个电子,成为未满带:导带



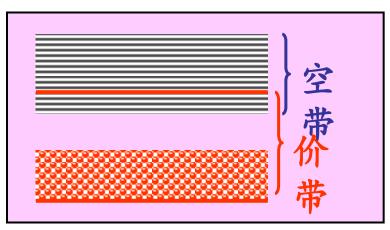
2价带为满带,与相邻空带紧密衔接或部分重叠。

例: Mg原子: 1s²2s²2p⁶3s² 每个原子二个价电子,3s能带形成满带(价带),但与空带重叠, 形成较宽的能带,为导带。



③价带为导带,又与空带部分重叠。

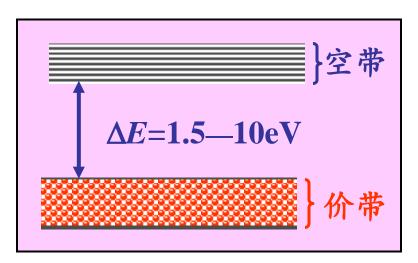
例: Na原子 1s²2s²2p⁶3s¹ 每个原子一个价电子,3s能带 形成导带(价带),又与空带 重叠,形成更宽导带。



要求:将三种导体的能带结构进行比较

(2)绝缘体的能带特征

能带特征: 价带为满带, 且与空带之间的禁带较宽。

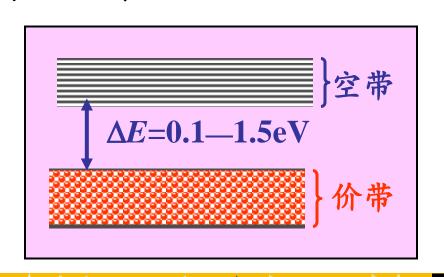


一般:从满带到空带激发微不足道,可以认为不存在导带。

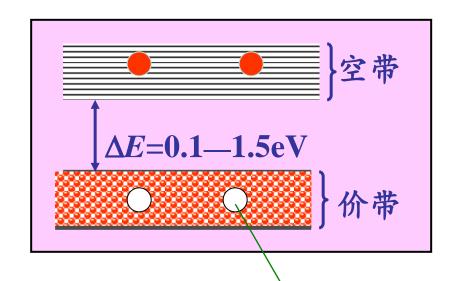
当外来激发使较多电子越过禁 带进入空带时,原空带-导带。 绝缘体击穿。

(3)半导体的能带特征

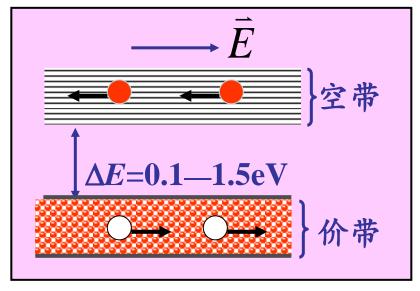
能带特征:价带为满带, 与空带之间的禁带较窄。



- 3.半导体分类
- (1)本征半导体(纯净半导体)



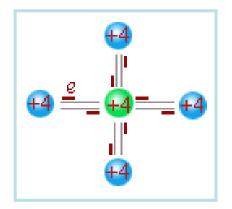
热运动足以使一些电子从满带进入空带,使空带成为导带,满带中留下空穴。

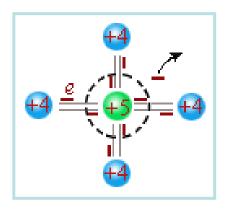


外场 子带中电子逆电场方向运动 ——电子导电作 原满带中电子填补空穴, 空穴沿电场方向运动 ——空穴导电

导带中的电子、价带中的空穴为本征载流子,且数目相等。(数量较少,导电能力弱)

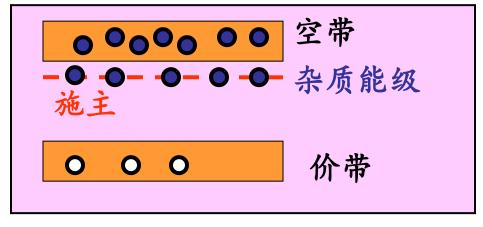
(2)N型半导体(四价元素中掺入五价元素)





N型半导体:

本征半导体+施主杂质 例 硅(Si)、 磷(P)、 如 锗(Ge) 砷(As)



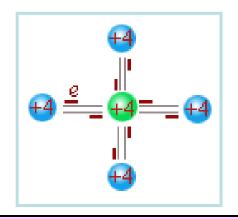
杂质能级接近空带底, 其上电子容易受激发 进入空带,使其电子 浓度增大。

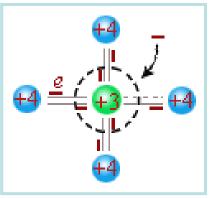
电子:多数载流子;空穴:少数载流子

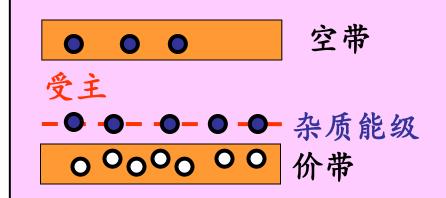
杂质能级 —— 施主能级

半导体以多数载流子电子导电为主

(3)P型半导体(四价元素中掺入三价元素)







P型半导体:

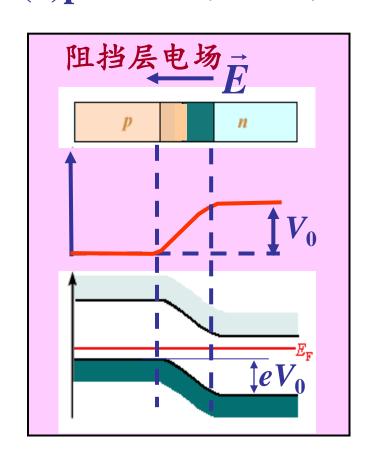
本征半导体+受主杂质 ↑ 例 硅(Si)、 硼(B)、 如 锗(Ge) 镓(Ga)

杂质能级接近满带顶, 满带中电子容易受激发 进入杂质能级,使满带 中空穴浓度增大。

空穴:多数载流子; 电子:少数载流子 杂质能级——受主能级 半导体以多数载流子空穴导电为主

4.p-n结及其单向导电性

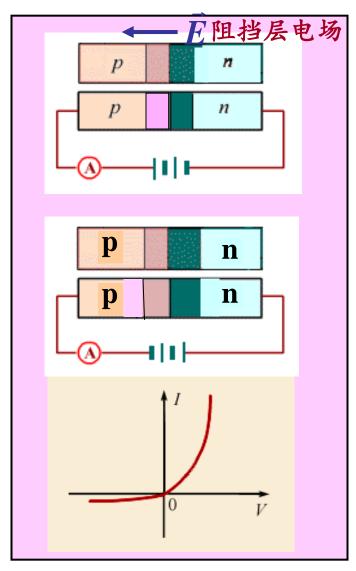
(1)p-n结的形成及其对扩散的阻挡作用



扩散运动。 扩散运动为多数载流子的运动 **电子:p**→n 漂移运动 { 空穴:n→p 漂移运动为少数载流子的运动 若扩散运动和漂移运动速率相 当, 半导体达到平衡。

电子能带弯曲, 电势高处, 电势能低。

(2)p-n结的单向导电性



p: + 电场E: p→n,阻挡层减n: - 弱,多数载流子导电,半导体导电。

p: 电场E: n→p, 阻挡层 n: + 加强, 少数载流子导电, 半导体不导电。

因此: p-n 结具有单向导电性

练习:激发本征半导体中传导电子的几种方法有 (1) 热 激发,(2)光激发,(3)用三价元素掺杂,(4)用五价元 素掺杂。对于纯锗和纯硅这类本征半导体, 在上述方 法中不能激发其传导电子的有

(A) (1)

(B) (2)

(C) (3)

(**D**)(4)

解: 热激发、光激发均能在导带中激发传导电子: 用 三价元素掺杂时,在价带中激发空穴:用五价元素掺 杂时,在导带中激发传导电子。

因此: 只有(3), 即用三价元素掺杂不能激发传导电 子。



作业

- 1.No.9.
- 2:自学本章各例题并完成书上的习题(对照书后的参考答案自己订正)。
- 3:自学:超导、超流、液晶。



第十四周星期三交作业

Thank You!

